

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成18年3月16日(2006.3.16)

【公開番号】特開2000-353700(P2000-353700A)

【公開日】平成12年12月19日(2000.12.19)

【出願番号】特願平11-166205

【国際特許分類】

H 01 L	21/316	(2006.01)
C 23 C	16/40	(2006.01)
H 01 L	21/31	(2006.01)
H 01 L	27/108	(2006.01)
H 01 L	21/8242	(2006.01)

【F I】

H 01 L	21/316	X
C 23 C	16/40	
H 01 L	21/31	B
H 01 L	27/10	6 5 1

【手続補正書】

【提出日】平成18年1月26日(2006.1.26)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0004

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0004】

このような状況下において、本発明者らは、従来の固体原料をテトラヒドロフラン(以下、THFと略する)という有機溶媒に溶解して溶液化することによって、気化性が飛躍的に向上することを見出し、これをCVD原料に用いることを提案した(特開平5-299365号公報)。しかし、この原料を、SiO₂膜形成用の、従来から用いられている液体原料用CVD装置を用いて誘電体膜を形成しても、必ずしも良好な結果が得られないことがわかった。そこで、本発明者らは、また、液体原料を十分に気化させて、反応室に安定に供給できる液体原料用CVD装置を提案した(特開平6-310444号公報、特開平7-94426号公報)。しかし、この溶液気化CVD装置を用いて誘電体膜を作製しても、必ずしも安定に良好な膜質(電気特性を含む)を有するものが得られるわけではないことがわかった。